炭素ドープ MgB2 薄膜の作製とその臨界電流特性

Fabrication and critical current properties for C-doped MgB₂ thin films 京大¹, 日立製作所²: [○]青木 翔太¹, 竹原 寛人¹, 堀井 滋¹, 土井 俊哉¹, 水上 貴彰², 楠 敏明², 菅野 周一²

Kyoto Univ.¹, Hitachi Ltd.²: Shota Aoki¹, Hiroto Takehara¹, Shigeru Horii¹, Toshiya Doi¹, Takaaki Mizukami², Toshiaki Kusunoki², Shuichi Kanno² E-mail: aoki.shota.47v@st.kyoto-u.ac.jp

【緒言】

MgB₂は,金属系超伝導物質の中で最も高い超伝 導転移温度(T_c=39 K)を有しており、ヘリウムフリ ーの冷凍機冷却あるいは液体水素による 15~30 K での応用が期待されている。しかし、20 K 近傍で の MgB₂の臨海電流特性の改善が実用化への課題 であり、MRI などの強磁場応用に向けて SiC, C な どのピンニングセンタ導入に関する研究が進めら れている。

本研究では、電子ビーム蒸着法で作製した MgB₂ 薄膜における臨界電流特性のさらなる向上を目的 として、MgB₂へのCドープを試み、磁束ピンニン グ特性の評価を行なった。

【実験】

MgB₂およびCドープMgB₂薄膜を電子ビーム(EB)蒸 着法でジュラルミン(Du)基板上に280℃で成膜した。 原料には鋳造Mg塊(3N),結晶性B(純度99.5%)と 結晶性B₄C(2Nup)を用い,B(C)側の原料はモル比が B:C=100:0,99:1,90:10となるように混合した。

得られた試料について, X 線回折(XRD)法により 生成相の同定を行い, B/Mg比を誘導結合プラズマ (ICP)発光分光分析から, C/B 比をエネルギー分散 型 X 線分光(EDX)から決定した。また,薄膜の T_c および不可逆曲線を四端子法から決定した。

【結果及び考察】

成膜した MgB₂薄膜の B/Mg 比および C/B 比を Table 1 に示す。ICP から Mg と B がおおよそ 1:2 で成膜されて いることが, EDX から C が薄膜内に何らかの形で取り込 まれていることがわかった。また,仕込みの C 量の増加 とともに薄膜内の C 量も増加する傾向も示した。

Fig. 1 に, C-free および C-doped MgB₂ 薄膜の電気 抵抗率の温度依存性を示す。まず, T_c に着目する と,いずれの試料も超伝導特性を示すものの,C ドープ量の増加とともに T_c は減少する。具体的に は,B:C=100:0,99:1,90:10において,それぞれ, T_c =34,30,19 K であった。この結果は EDX で検出 した C は MgB₂内に固溶していることを示唆する。 また,電気抵抗率の温度依存性も C ドープ量の増 加とともに半導体的挙動に変化しており,MgB₂へ の C の固溶を支持する結果となった。

Fig.2に磁場中電気抵抗から決定した C-free およ

び C-doped MgB₂薄膜の不可逆曲線を示す。なお、 横軸は T_c で規格化した温度であり、不可逆温度は 超伝導転移温度直上の抵抗率の 1/100 の抵抗率を 示す温度とした。B:C=100:0 および B:C=99:1 の不 可逆曲線はほぼ一致しており、この結果を見る限 り、炭素ドープは MgB₂の不可逆磁場向上に寄与し ていないと考えられる。当日は、C-doped MgB₂薄 膜の臨界電流密度の磁場依存性の結果についても 示すとともに、MgB₂薄膜における C の磁束ピンニ ング効果について議論する予定である。

Table	1	Chemical	compositions	for	the	obtained
C-doped and C-free MgB ₂ thin films.						



Fig. 1 Temperature dependences of the electrical resistivity for the C-free and C-doped MgB_2 thin films.



Fig. 2 Irreversibility lines for the C-free and C-doped MgB_2 thin films.